# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-310109

(43) Date of publication of application: 06.11.2001

(51)Int.Cl.

B01D 53/04 B01D 53/14 F24F 7/00 // A61L 9/00 A61L

6

(21)Application number: 2001-044945

(71)Applicant: NICHIAS CORP

(22)Date of filing:

21.02.2001

(72)Inventor: TANAKA MINORU

TANIGUCHI TAKASHI SASAKI HARUKO

NAKANO TOSHIAKI

(30)Priority

Priority number: 2000042709

Priority date : 21.02.2000

Priority country: JP

# (54) CHEMICAL FILTER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a chemical filter capable of carrying the remarkable amount of active carbon, increasing, therefore, the carrying amount of a reactive material by immersing and carrying a reactive material, provided with the superior performance of removing a gaseous polluted material and small pressure loss and also provided with an improved life. SOLUTION: This chemical filter is formed of a corrugated honeycomb structural body provided with an adsorption filter medium for removing gaseous impurities and cohesive organic substances in air, and the adsorption filter medium is formed of a fiber base paper of the fiber void content of 80-95% and carrying the gas adsorption material or the gas reactive material.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

14.10.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-310109 (P2001-310109A)

(43)公開日 平成13年11月6日(2001.11.6)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I デーマコート*(参考)
B01D 53	/04	B 0 1 D 53/04 A
53,	/14 ZAB	53/14 ZABA
F24F 7	/00	F 2 4 F 7/00 A
// A61L 9	/00	A 6 1 L 9/00 C
9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9/16 D
		審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 8 ]
(21)出願番号	特願2001-44945(P2001-44945	) (71)出願人 000110804
		ニチアス株式会社
(22)出顧日	平成13年2月21日(2001.2.21)	東京都港区芝大門1丁目1番26号
		(72)発明者 田中 実
(31)優先権主張	番号 特願2000-42709(P2000-42709	神奈川県横浜市鶴見区大黒町1-70 二
(32)優先日	平成12年2月21日(2000.2.21)	アス株式会社内
(33)優先権主張	国 日本(JP)	(72)発明者 谷口 隆志
		神奈川県横浜市鶴見区大黒町1-70 二
		アス株式会社内
		(74)代理人 100098682
		弁理士 赤塚 賢次 (外1名)
		最終質に組

# (54) 【発明の名称】 ケミカルフィルタ

# (57)【要約】

【課題】 活性炭の担持量が格段に高く、従って、反応材を含浸担持すれば、反応材の担持量を増加でき、ガス状汚染物質の除去性能が優れると共に、圧力損失が小さく、寿命が向上したケミカルフィルタを提供すること。

【解決手段】 空気中のガス状不純物及び凝集性有機物質を除去する吸着滤材を有するコルゲート状ハニカム構造体のケミカルフィルタであって、前記吸着滤材は繊維間空隙率80~95%の繊維基紙にガス吸着材又はガス反応材を担持したものであるケミカルフィルタ。

1

## 【特許請求の範囲】

空気中のガス状不純物及び凝集性有機物 【請求項1】 質を除去する吸着濾材を有するコルゲート状ハニカム構 造体のケミカルフィルタであって、前記吸着濾材は繊維 間空隙率80~95%の繊維基紙にガス吸着材又はガス 吸着材及びガス反応材を担持したものであることを特徴 とするケミカルフィルタ。

【請求項2】 前記ガス吸着材は活性炭又はゼオライト であって、且つ前記繊維基紙の単位面積当たりの活性炭 又はゼオライト担持量が40~150g/m²の範囲である ことを特徴とする請求項1記載のケミカルフィルタ。

【請求項3】 前記ガス反応材は、無機塩基又は無機酸 あるいは無機酸塩であることを特徴とする請求項1又は 2記載のケミカルフィルタ。

【請求項4】 前記繊維基紙は、ガラス繊維、セラミッ ク繊維、アルミナ繊維、ムライト繊維、シリカ繊維及び 有機繊維から選ばれる1種又は2種以上の素材からなる ものであることを特徴とする請求項1~3のいずれか1 項に記載のケミカルフィルタ。

【請求項5】 繊維間空隙率80~95%の繊維基紙に 活性炭又はゼオライトを該繊維基紙の単位面積当たりの 活性炭又はゼオライト担持量が40~150g/m²の範囲 となるように担持させ、次いで、該活性炭又はゼオライ ト担持繊維基紙をコルゲート状ハニカム構造体に成形し た後、該コルゲート状ハニカム構造体にガス反応材を担 持させることを特徴とするケミカルフィルタの製造方 法。

【請求項6】 繊維間空隙率80~95%の繊維基紙を コルゲート状ハニカム構造体に成形した後、該コルゲー ト状ハニカム構造体に活性炭又はゼオライトを該コルゲ ート状ハニカム構造体を構成する繊維基紙の単位面積当 たりの活性炭又はゼオライト担持量が40~150g/m² の範囲となるように担持させ、次いで、該コルゲート状 ハニカム構造体にガス反応材を担持させることを特徴と するケミカルフィルタの製造方法。

【請求項7】 繊維間空隙率80~95%の繊維基紙に 活性炭又はゼオライトを吸水量が100~160g/m²と なるように担持させ、次いで、該活性炭担持繊維基紙を ガス反応材と反応しない有機系接着剤又は無機系接着剤 から選ばれる1種以上の接着剤でコルゲート状ハニカム 構造体に成形した後、該コルゲート状ハニカム構造体に 塩基性ガス又は酸性ガスを吸収するガス反応材を担持さ せることを特徴とするケミカルフィルタの製造方法。

【請求項8】 繊維間空隙率80~95%の繊維基紙を ガス反応材と反応しない有機系接着剤又は無機系接着剤 から選ばれる1種以上の接着剤でコルゲート状ハニカム 構造体に成形した後、該コルゲート状ハニカム構造体に 活性炭又はゼオライトを吸水量が100~160g/m²と なるように担持させ、次いで、該コルゲート状ハニカム 構造体に塩基性ガス又は酸性ガスを吸収するガス反応材 50 アミン類などの塩基性ガス汚染物質を除去している。他

を担持させることを特徴とするケミカルフィルタの製造 方法。

【請求項9】 前記有機系接着剤が、フェノール系樹 脂、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂及びこれら共重合 体から選ばれる1種以上であり、前記無機系接着剤が、 シリカゾル及びアルミナゾルから選ばれる1種以上であ ることを特徴とする請求項7又は8記載のケミカルフィ ルタの製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体製造 工場や精密電子製造工場のクリーンルーム及びクリーン ルーム内で使用される装置(デバイス)に使用される極 微量のガス状不純物成分を除去する空気清浄用のケミカ ルフィルタに関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】半導体製造工場におけるシリコンウエハ ーなどの製造工程において、64MビットDRAMまで のデバイスではクリーンルーム中のパーティクルや金属 不純物などの汚染物が欠陥の原因となるため、これらの 汚染物をHEPAフィルタやULPAフィルタを介して 極限まで除去している。しかし、64MビットDRAM 以上のデバイスにおいてはクリーンルーム内のppbレ ベルのガス状汚染物が製品の歩留り低下の原因となって いる。これらのガス状汚染物質は外気からの侵入、クリ ーンルーム構成部材からのアウトガス、プロセス上の薬 品などが原因であることが知られている。

【0003】これらガス状汚染物質をppbオーダ以下 まで低濃度化する場合にはクリーンルーム内でケミカル フィルタを使用して、汚染物質を除去する方法が採られ ている。ケミカルフィルタは例えば、活性炭のような吸 着材を素材としたフィルタにクリーンルームやデバイス 内の空気を通過させ、ガス状汚染物質を除去するもので ある。ガス状汚染物質は酸、アルカリ及び有機物に分類 され、一般的にはケミカルフィルタはこれらのガス状汚 染物質を効率よく除去するため、ガスを吸着する吸着材 やガスを吸収する反応材を適宜に選定して担持したもの が使用される。

【0004】例えば、アミン類は大気中に数十ppb含 40 まれており、外気を採り入れる際にクリーンルーム内に 侵入する。また、クリーンルーム内の建材、プロセス用 の薬品からもアミン類などの塩基性ガス汚染物質が発生 していることが知られている。これら塩基性ガス汚染物 質がクリーンルーム内に10~20ppb存在すると、 フォトレジスタンスの形状異常を引き起こし(Tトップ 現象)、また、酸性ガスと反応することにより塩を形成 し、プロセス装置の光学部品やシリコーンウエーハ表面 に曇りを生じさせる。このため、ガスを吸収する反応材 として酸性物質を担持したケミカルフィルタを使用し、

3

方、クリーンルーム内に酸性ガス汚染物質が存在すると、除塵フィルタのガラス繊維を腐食することによりボロンの発生を促進し、また、ICなどの金属腐食を引き起こす。このような酸性ガス汚染物質対策のため、ガスを吸収する反応材として塩基性物質を担持したケミカルフィルタを使用し、酸性ガス汚染物質を除去している。

【0005】従来、ガスを吸収させる反応材として粒状活性炭を使用し、該粒状活性炭をフィルターケースに充填したケミカルフィルタがある。しかし、このケミカルフィルタは圧力損失が大きい。また、粒状活性炭は被処理気体との接触面積が少ないため、除去効率が悪いなどの欠点がある。更に、活性炭素繊維の不織布をコルゲートしたハニカム構造体ケミカルフィルタもあるが、圧力損失が大きく、製造コストが高いという問題がある。クリーンルームでは高洗浄度を保つために、HEPAフィルタ、ULPAフィルタ及びケミカルフィルタなどに空間内の空気を通して循環させているため、これらフィルターの圧力損失が大きい場合、送風ブロアの大容量化、送風エネルギーの増大などの問題が生じることとなる。

【0006】このため、圧力損失が小さい、接触面積が 20 大きいなどの理由から、粉末状活性炭と有機繊維をハニカム 構造に成形した後、該成形体をガス状汚染物質を中和できる無機酸や金属塩などを溶解した水溶液に含浸し、この無機酸や金属塩などのガス反応材を活性炭に担持させることによって得られるケミカルフィルタも提案されている。このケミカルフィルタは粒状活性炭をフィルターケースに充填したケミカルフィルタに比べて密度が小さく、圧力損失も低くすることが可能である点で有利である。 30

## [0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来のハニカム構造体ケミカルフィルタにおいては、紙の抄造工程で有機繊維と活性炭の混合物を抄き込むために、活性炭担持量を多くさせることができず、多くとも紙の単位面積当たりの活性炭担持量は40g/m²程度、吸水量も80g/m²程度である。このため、ガス反応材を含浸担持するとき、ガス反応材の担持量は増加せず、ガス状汚染物質の除去性能や寿命の点で十分に満足できるものとは言い難い。

【0008】従って、本発明の目的は、吸着剤である活性炭やゼオライトの担持量が格段に高く、従って、反応材を含浸担持すれば、反応材の担持量を増加でき、ガス状汚染物質の除去性能が優れると共に、圧力損失が小さく、寿命が向上したケミカルフィルタを提供することにある。

# [0009]

【課題を解決するための手段】かかる実情において、本 発明者らは鋭意検討を行った結果、空気中のガス状不純 物及び凝集性有機物質を除去する吸着濾材を有するコル ゲート状ハニカム構造体のケミカルフィルタにおいて、 繊維間空隙率80~95%の繊維基紙に例えば、活性炭 やゼオライトなどの吸着剤を担持させる際、該吸着剤を

該繊維間の空隙を塞ぐように高割合量を充填させ吸着剤 高担持量の無機繊維基紙を得、その後、コルゲート状ハ ニカム構造体に成形した後、該ハニカム構造体にガス反 応材を担持するなどの方法を採れば、反応材の担持量を 増加でき、ガス状汚染物質の除去性能が優れると共に、

圧力損失が小さく、寿命が向上すること等を見出し、本 発明を完成するに至った。

【0010】すなわち、本発明は、空気中のガス状不純物及び凝集性有機物質を除去する吸着濾材を有するコルゲート状ハニカム構造体のケミカルフィルタであって、前記吸着濾材は繊維間空隙率80~95%の繊維基紙にガス吸着材又はガス吸着材及びガス反応材を担持したものであるケミカルフィルタを提供するものである。

【0011】また、本発明は、繊維間空隙率80~95

%の繊維基紙に活性炭又はゼオライトを該繊維基紙の単 位面積当たりの活性炭又はゼオライト担持量が40~1 50g/m²の範囲となるように担持させ、次いで、該活性 炭又はゼオライト担持繊維基紙をコルゲート状ハニカム 構造体に成形した後、該コルゲート状ハニカム構造体に ガス反応材を担持させるケミカルフィルタの製造方法を 提供するものである。また、本発明は、繊維間空隙率8 0~95%の繊維基紙をコルゲート状ハニカム構造体に 成形した後、該コルゲート状ハニカム構造体に活性炭又 はゼオライトを該コルゲート状ハニカム構造体を構成す る繊維基紙の単位面積当たりの活性炭又はゼオライト担 持量が40~150g/m²の範囲となるように担持させ、 次いで、該コルゲート状ハニカム構造体にガス反応材を 30 担持させるケミカルフィルタの製造方法を提供するもの である。また、本発明は、繊維間空隙率80~95%の 繊維基紙に活性炭又はゼオライトを吸水量が100~1 6 0g/m²となるように担持させ、次いで、該活性炭担持 繊維基紙をガス反応材と反応しない有機系接着剤又は無 機系接着剤から選ばれる1種以上の接着剤でコルゲート 状ハニカム構造体に成形した後、該コルゲート状ハニカ ム構造体に塩基性ガス又は酸性ガスを吸収するガス反応 材を担持させるケミカルフィルタの製造方法を提供する ものである。また、本発明は、繊維間空隙率80~95 %の繊維基紙をガス反応材と反応しない有機系接着剤又 は無機系接着剤から選ばれる1種以上の接着剤でコルゲ ート状ハニカム構造体に成形した後、該コルゲート状ハ ニカム構造体に活性炭又はゼオライトを吸水量が100 ~160g/m²となるように担持させ、次いで、該コルゲ ート状ハニカム構造体に塩基性ガス又は酸性ガスを吸収

#### [0012]

法を提供するものである。

【発明の実施の形態】本発明のケミカルフィルタは、空

するガス反応材を担持させるケミカルフィルタの製造方

気中の酸性ガスやアルカリ性ガス等のガス状不純物や凝集性有機物質を除去する目的で使用される。ここで、凝集性有機物質とは物体の表面で凝集することがある空気中に浮遊している揮発性の有機物質で、例えば、ジオクチルフタレート、ジブチルフタレート、ジメチルシロキサン、ヘキサメチルジシロキサン、Nーメチルー2ーピロリドン等が挙げられる。該ケミカルフィルタはこれらガス状不純物や凝集性有機物質を除去するコルゲート状ハニカム構造体の吸着濾材を有するものであり、通常、吸着濾材及びこの吸着濾材を支持する部材とからなる。

【0013】本発明のケミカルフィルタにおいて、吸着 濾材は繊維間空隙率80~95%の繊維基紙にガス吸着 材又はガス反応材を担持したものであり、且つコルゲー ト状ハニカム構造体であれば、特に制限されない。繊維 基紙とは繊維から形成される織布又は不織布を言う。繊 維としては、Eガラス繊維、NCR繊維、ARG繊維、 ECG繊維、Sガラス繊維、Aガラス繊維などのガラス 繊維、チョップドストランド、セラミック繊維、アルミ ナ繊維、ムライト繊維、シリカ繊維、ロックウール繊 維、炭素繊維等の無機繊維及び有機繊維が挙げられる。 有機繊維としては、アラミド繊維、ナイロン繊維、ポリ エチレンテレフタレート繊維などが使用できる。繊維基 紙は無機繊維を使用することがケミカルフィルタの強度 を高めることができる点で好ましい。これらの無機繊維 及び有機繊維の形状等は特に制限さないが、繊維長は 0. 1~50mmのもの、繊維径は0. 1~25μm のも のの使用が好ましい。これらの無機繊維及び有機繊維は 1種又は2種以上を組み合わせて使用できる。

【0014】ガス吸着材又はガス吸着材及びガス反応材が担持される繊維基紙の繊維間空隙率は80~95%であるが、90~95%が好ましい。繊維基紙の繊維間空隙率を上記範囲内とすれば、該繊維間の空隙にガス吸着材である活性炭やゼオライトを塗工担持させる際、活性炭やゼオライトを該繊維間の空隙を塞ぐように高割合量を充填することができる。繊維間空隙率は繊維基紙の見かけの体積に対して、該見かけの体積から繊維基紙中の該無機繊維の占める体積を引いた部分(空隙部分の体積)の比率を言う。

【0015】ガス吸着材としては、活性炭又はゼオライトが挙げられる。活性炭又はゼオライトは凝集性有機物質を吸着させる目的で用いる。この活性炭又はゼオライトを吸着材として用いた凝集性有機物質を吸着するケミカルフィルターは、活性炭やゼオライトの細孔に凝集性有機物質をファンデルワールス力などで物理吸着させるので、酸や塩基などの添着物質を必要としない。

【0016】ガス反応材としては、酸性ガスを吸収させる反応材及び塩基性ガスを吸収させる反応材が挙げられる。酸性ガスを吸収させる反応材としては、広くアルカリ性の無機塩が使用できる。このような無機塩としては、炭酸カリウム等のアルカリ塩などが挙げられる。ま

た、塩基性ガスを吸収させる反応材としては、広く無機 酸及び酸性の無機塩が使用できる。無機酸としては、硫 酸などが挙げられ、酸性の無機塩としては硫酸鉄などの 硫酸塩が挙げられる。

【0017】前記繊維基紙に対するガス吸着材の担持量としては、前記繊維基紙の単位面積当たりの活性炭又はゼオライト担持量が40~150g/m²、好ましくは60~120g/m²、特に好ましくは80~120g/m²である。また、この活性炭又はゼオライト担持による活性炭又はゼオライトの吸水量は100~160g/m²、好ましくは120~150g/m²である。活性炭又はゼオライト担持量及び吸水量が上記範囲にあれば、ガス反応材の患者量も高められ、優れたガス状汚染物質除去性能が得られる。前記繊維基紙に対するガス反応材の担持量としては、アルカリ性汚染物質の除去を目的として硫酸を使用した場合、5~30kg/m³とすることが好ましく、酸性汚染物質の除去を目的として炭酸カリウムを使用した場合、30~60kg/m³とすることが好ましい。

【0018】次に、本発明のケミカルフィルタの第1の 製造例について説明する。先ず、繊維間空隙率80~9 5%の繊維基紙を得る。繊維基紙は上記のものと同様の ものが使用できるが、無機繊維を使用することが製造さ れたケミカルフィルタの強度を高めることができるなど の点で好ましい。先ず、1種又は2種以上の繊維をポリ ビニルアルコール、ポリアクリルアミド又はメチルセル ロース等の有機バインダが添加された溶液中に分散して スラリーを形成する。例えば、このスラリーを形成する 際、有機バインダの配合量は繊維100重量部に対し て、5~25重量部、好ましくは10~15重量部、ま た、繊維の配合量はスラリー中、0.5~3重量%、好 ましくは0.5~1重量%とするのが、抄造性に優れ、 均質で繊維間空隙を高めた繊維を得ることができる点か ら好ましい。繊維の配合量が0.5重量%未満では仕上 がりのきれいな基紙が得られるものの、多量の水を必要 としコスト高となると共に、所望の強度が得られ難い。 一方、3重量%を越えると厚さが不均一で粗密であるな ど不良品となり易く、且つ繊維間空隙を高めた繊維が得 られ難くなる。次いで、該スラリーを例えば丸網抄造機 などの抄造機を使用する公知の抄造法で繊維基紙(不織 40 布)とする。繊維基紙の繊維間空隙率を80~95%と するには、特に、繊維に対する有機バインダーの配合量 を上記の範囲とすることにより容易に得ることができ る。

【0019】次いで、繊維間空隙率80~95%の繊維 基紙に活性炭又はゼオライトを該繊維基紙の単位面積当 たりの担持量が40~150g/m²、好ましくは60~1 20g/m²、特に好ましくは80~120g/m²の範囲とな るように担持する。また、この活性炭又はゼオライト担 持による活性炭又はゼオライトの吸水量は100~16 500g/m²、好ましくは120~150g/m²である。活性炭 又はゼオライトを上記範囲内に担持するには繊維間空隙に、50~350kg/m³の割合で粉末状活性炭又はゼオライトを塗工担持すればよい。活性炭又はゼオライト担持量及び吸水量が上記範囲にあれば、ガス反応材の添着量も高められ、優れたガス状汚染物質除去性能が得られる。担持方法は粉末活性炭又はゼオライト及びバインダーの懸濁液を塗工する方法が、繊維間の隙間を塞ぐように活性炭を充填して、高割合の活性炭を担持できる点で好ましい。バインダーとしては、塩化ビニリデン系バインダー、塩化ビニルアクリル共重合系バインダー、アク 10 リル系バインダー、ポリエステル系バインダー、スチレ

れ、このうち、塩化ビニリデン系バインダーが難燃性が 発揮できる点で好ましい。活性炭の塗工はヘラ塗り、刷 毛塗り又はロール塗りが使用でき、塗布、乾燥後、加熱 処理して活性炭塗工繊維基紙を作製する。加熱処理は7 0~120℃の温度範囲で行えばよい。

ン系バインダー、ラテックス系バインダーなどが挙げら

【0020】次いで、該活性炭又はゼオライト担持繊維 基紙をコルゲート状ハニカム構造体に成形する。先ず、 該活性炭又はゼオライト担持無機繊維基紙をコルゲート 加工するものと、コルゲート加工しないものとに分け る。コルゲート加工するものは、上下一対の波形段ロー ルの間を通してコルゲート状物とする。このコルゲート 状物の山部に接着剤を付け、コルゲート加工していない 平坦状物を重ね合わせ、コルゲート状物の山部と平坦状 物との接触する部分で接着を図る。この接着を複数のコ ルゲート状物と平坦状物との間で交互に行い積層するこ とで、通気方向に対して所定の開口率のハニカム構造体 を形成することができる。接着に使用する接着剤として は、適度な施工性と接着性を有するものであれば、特に 制限されないが、フェノール系樹脂、エポキシ系樹脂、 アクリル系樹脂、酢酸ビニル系樹脂及びこれらの共重合 体などの有機接着剤、シリカゾル、アルミナゾル等の無 機接着剤が使用できる。後述するガス反応材として塩基 性ガス又は酸性ガスを吸収する反応材を使用する場合、 接着剤は、当該塩基性ガス又は酸性ガスを吸収するガス 反応材と反応しない有機系接着剤又は無機系接着剤から 選ばれる1種以上が好ましく、具体的には、フェノール 系樹脂、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂及びこれら共 重合体から選ばれる1種以上の有機系接着剤又はシリカ ゾル及びアルミナゾルから選ばれる1種以上の無機系接 着剤を使用することがガス反応材と加水分解反応が起き にくい点で好ましい。また、特に好ましい接着剤はアク リル系共重合樹脂である。更に、アクリル系共重合樹脂 と無機接着剤を併用すれば、耐酸性がより向上する。ハ ニカム構造体の断面形状としては、特に制限されず、円 形状、四角状などが挙げられる。

【0021】次いで、必要に応じて該コルゲート状ハニカム構造体にガス反応材を担持させる。ガス反応材は前述のガス反応材が使用できる。該コルゲート状ハニカム

構造体にガス反応材を担持させる吸着濾材は用途に応じ て、酸やアルカリなどの物質を添着したものが使用され る。すなわち、ガス状汚染物質が塩基性ガスであれば、 ガス反応材は例えば、酸性化合物を添着したもの、ま た、ガス状汚染物質が酸性であれば、ガス反応材は例え ば、塩基性化合物を添着したものが使用される。これら ガス反応材又はガス吸着材の種類及び添着、担持方法と しては、公知の方法が適用され、例えばガス反応材とし て酸を含む吸着濾材は、例えば該ハニカム構造体を硫酸 濃度数%~十数%の水溶液に数分間~数時間浸漬した り、又はウオッシュコートなどで吸水担持させた後、乾 燥して得られる。また、例えばガス反応材としてアルカ リを含む吸着遮材は、例えば該ハニカム構造体を炭酸カ リウム濃度数%~十数%の水溶液に数分間~数時間浸漬 したり、又はウオッシュコートなどで吸水担持させた 後、乾燥して得られる。ガス反応材を溶解させる液とし ては、水、アルコールなどを適宜選択して使用される。 吸着濾材である繊維基紙に対するガス反応材の担持量の 具体例としては、アルカリ性汚染物質の除去を目的とし て硫酸を使用した場合、5~30kg/m³ とすることが好 ましく、酸性汚染物質の除去を目的として炭酸カリウム を使用した場合、30~60kg/m3 とすることが好まし い。本第1の方法においては、ハニカム構造体を形成し た後にガス反応材の添着を行うから、ガス反応材が脱離 することがない。

【0022】次に、本発明のケミカルフィルタの第2の 製造例について説明する。第2の製造例において、第1 の製造例と同一の構成についてはその説明を省略し、異 なる点について主に説明する。第1の製造例と異なる点 は、第1の製造例が特定の繊維間空隙率を有する繊維基 紙にガス吸着材を担持した後にコルゲート状ハニカム構 造体を成形する方法であるのに対して、第2の製造例で は特定の繊維間空隙率を有する繊維基紙をコルゲート状 ハニカム構造体に成形した後にガス吸着材を担持する方 法である。コルゲート状ハニカム構造体に活性炭又はゼ オライトを該コルゲート状ハニカム構造体を構成する繊 維基紙の単位面積当たりの活性炭又はゼオライト担持量 が40~150g/m²の範囲となるように担持させる方法 としては、活性炭又はゼオライトなどの吸着材が10~ 60重量%で含まれるスラリーを調整し、該スラリーに 該コルゲート状ハニカム構造体を含浸させる方法が適用 できる。この方法においても第1の製造例と同様に、繊 維間の隙間を塞ぐように活性炭などを充填でき、高割合 の活性炭又はゼオライトを担持することができる。ま た、繊維間空隙率80~95%の繊維基紙をガス反応材 と反応しない有機系接着剤又は無機系接着剤から選ばれ る1種以上の接着剤でコルゲート状ハニカム構造体に成 形した後、該コルゲート状ハニカム構造体に活性炭又は ゼオライトを吸水量が100~160g/m²となるように 50 担持させれば、同様に、ガス反応材の添着量も高めら

10

れ、優れたガス状汚染物質除去性能のフィルタを得ることができる。

【0023】本発明のケミカルフィルタは、吸着濾材であるコルゲート状ハニカム構造体と、該吸着濾材を支持する支持部材(ケーシング)とで構成される。該支持部材はコルゲート状ハニカム構造体を支持すると共に、既存設備(設置場所)との接合を司る機能を有する。支持部材の処理空気流通部分は、脱ガスのないステンレス、アルミニウム、プラスチックなどの素材からなる。

【0024】本発明のケミカルフィルタは、更に、前記吸着濾材の下流側に、少なくとも前記吸着濾材から発生する微粒子を捕捉する除塵フィルタを設置することができる。これにより、後段の除塵フィルタで前段の吸着濾材から発生する粒子状不純物を除去することができる。本発明のケミカルフィルタを、例えば半導体製造工場のクリーンルーム内に設置した場合、半導体や精密電子部品製造における歩留りの一層の向上が図れる

【0025】本発明のケミカルフィルタの設置場所としては、特に制限されないが、例えば、半導体製造工場や精密電子製造工場のクリーンルームで使用される空気清 20 浄用やクリーンルームに設置されたデバイス内の空気清浄用として使用すれば、ガス状汚染物質の除去性能が優れると共に、圧力損失が小さく、寿命が向上する。これに伴い、半導体や精密電子部品の汚染物質を除去して歩留りの向上が図れる。

# [0026]

【実施例】次に、実施例を挙げて本発明を更に具体的に 説明するが、これは単に例示であって本発明を制限する ものではない。

## 実施例1

(ケミカルフィルタの作製) バインダとしてのポリビニ ルアルコールが繊維100重量部に対して、10重量部 で添加された溶液中に、Eガラス繊維をスラリー中、1 重量%となるように分散し、丸網抄造機で常法により抄 造し、繊維間空隙率が90%のEガラス繊維基紙を得 た。次いで、該Eガラス繊維基紙に粉末活性炭及び塩化 ビニリデン系バインダーを含む懸濁液を活性炭担持量が 9 0g/m²(吸水率1 2 0g/m²)となるように塗布し、乾 燥後、110℃の温度で処理して活性炭塗工ガラス繊維 基紙を作製した。この活性炭塗工ガラス繊維基紙をコル ゲート加工するものと、コルゲート加工しないものとに 分け、コルゲート加工するものは、上下一対の波形段ロ ールの間を通してコルゲート状物とした。このコルゲー ト状物の山部にアクリル樹脂系接着剤を付け、コルゲー ト加工していない平坦状物を重ね合わせ積層し、これを 繰り返して行い、波状コルゲートのピッチ (p) 3. 3 mm、セル高さ(h) 1.9 mm、壁厚(t) 0.3 mmの積 層体である平板状ハニカム構造体を得た(図1)。次い で、平板状ハニカム構造体を、ガスを吸着させる反応材 として5%硫酸水溶液に含浸し、その後、乾燥してアル カリ性汚染物質としてアンモニア除去を目的としたケミカルフィルタを作製した。この時の硫酸の担持量は20kg/m³であった。

【0027】(性能試験I)実施例1で作製したアンモニア除去用ケミカルフィルタを下記の試験条件下、該ケミカルフィルタ通過気流中のアンモニア量を経時的に測定し、ケミカルフィルタのアンモニア除去率で評価した。なお、実際にクリーンルームで問題となるアンモニアの濃度は数十ppbであるが、本試験では疑似的に20ppmの濃度で測定を行った。結果を図2に示す。その結果、60分経過後もアンモニア除去率80%を維持できた。

## <試験条件>

· 通気風速: 0. 3 m/s

・通気アンモニウム濃度:20ppm

・通気方向のハニカム構造体の厚さ: 10mm

·通気時間:0~60分

【0028】(性能試験II) 実施例1で作製したアンモニア除去用ケミカルフィルタを下記の試験条件下、該ケミカルフィルタの通過風速 (m/s)の増加に伴う圧力損失(Pa)を測定した。結果を図2に示す。その結果、通過風速が4m/s になっても、圧力損失は100Pa未満に保つことができた。

#### <試験条件>

·通気面速: 0~4m/s

・通気方向のハニカム構造体の厚さ: 4 0 mm

## 【0029】比較例1

繊維間空隙率が90%のEガラス繊維基紙の代わりに、 繊維間空隙率が60%のEガラス繊維基紙を使用した以 外は、実施例1と同様の方法及び評価を行った。このケ ミカルフィルタの硫酸の担持量は10kg/m³であった。 結果を図2に示す。その結果、通過風速は4m/sであっ ても圧力損失は100Pa未満と実施例1と同様の結果を 示すものの、60分経過後のアンモニア除去率は70% であり、実施例1と比較して低下した。

## 【0030】比較例2

直径約5mmの粒状活性炭を5%硫酸水溶液に含浸し、乾燥した。この硫酸が担持された粒状活性炭をフィルターケースに充填し、塩基性ガス除去用のケミカルフィルタを作製した。該ケミカルフィルタの硫酸の担持量は10kg/m³であった。該ケミカルフィルタの評価方法は実施例1と同様の方法で行った。結果を図2に示す。その結果、60分経過後のアンモニア除去率は60%程度であり、実施例1と比較して劣るものであり、また、通過風速は1.5m/sで、圧力損失は300Paを超えてしまった

## 【0031】参考例1

(ケミカルフィルタの作製及び性能評価) パルブ等から なる有機繊維と粉末活性炭の混合物を抄造して、粉末活 50 性炭の担持量40g/m²(吸水率80g/m²)の有機繊維基

紙を作製し、次いで、この活性炭含有有機繊維基紙をコ ルゲート加工するものと、コルゲート加工しないものと に分け、コルゲート加工するものは、上下一対の波形段 ロールの間を通してコルゲート状物とした。このコルゲ ート状物の山部にアクリル樹脂系接着剤を付け、コルゲ ート加工していない平坦状物を重ね合わせ積層し、これ を繰り返して行い、波状コルゲートのピッチ (p) 3. 3mm、セル高さ(h) 1. 9mm、壁厚(t) 0. 3mmの 積層体である平板状ハニカム構造体を得た。次いで、平 板状ハニカム構造体を、ガスを吸着させる反応材として 10 5%硫酸水溶液に含浸し、その後、乾燥してアルカリ性 汚染物質としてアンモニア除去を目的としたケミカルフ ィルタを作製した。この時の硫酸の担持量は5kg/m³で あった。このケミカルフィルタは実施例1と同様の評価 を行った。結果を図2に示す。その結果、通過風速は4 m/s であっても圧力損失は100Pa未満と実施例1と同 様の結果を示すものの、50分経過後のアンモニア除去 率は0%であり、実施例1と比較して大きく劣った。

11

# 【0032】参考例2

予め、粉末活性炭を5%硫酸水溶液に含浸し、乾燥し、硫酸担持活性炭を得た。次いで、実施例1で得られたのと同じEガラス繊維基紙にこの硫酸担持活性炭及び塩化ビニリデン系バインダーを含む懸濁液を、実施例1と同じ塗布量で塗布し、乾燥後、110℃の温度で処理して活性炭塗工ガラス繊維基紙を作製した。この活性炭塗工ガラス繊維基紙を実施例1と同様の方法で同形状の平板状ハニカム構造体を得、アルカリ性汚染物質としてアン

モニア除去を目的としたケミカルフィルタを作製した。この時の硫酸の担持量は8kg/m³であった。このように、硫酸の担持量が実施例1と比較して少ないのは、比較例4のように予め硫酸を添着させた活性炭をEガラス繊維基紙に塗布する方法では、懸濁液(スラリー)調製の際、硫酸が該懸濁液中に流出してしまい担持量が減少するためである。該ケミカルフィルタの評価方法は実施例1と同様の方法で行った。結果を図2に示す。その結果、実施例1と比較して、圧力損失は同程度であるものの、60分経過後のアンモニア除去率は65%程度であり、劣るものであった。

12

# [0033]

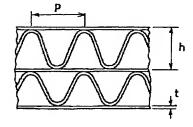
【発明の効果】本発明は、繊維間空隙率80~95%の 繊維基紙に例えば、活性炭を担持させる際、活性炭を該 繊維間の空隙を塞ぐように高割合量を充填させ活性炭高 担持量の繊維基紙を得、その後、コルゲート状ハニカム 構造体に成形した後、該ハニカム構造体にガス反応材を 担持するようにしたため、反応材の担持量を増加でき、 ガス状汚染物質の除去性能を格段に優れたものにでき る。また、吸着濾材はコルゲート状ハニカム構造体であ るため、圧力損失が小さく、寿命が一段と向上する。

## 【図面の簡単な説明】

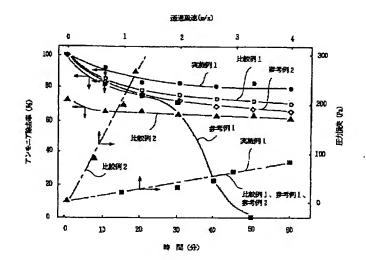
【図1】実施例1で得られたコルゲート状ハニカム構造体の一部の側面図である。

【図2】実施例及び比較例のケミカルフィルタのアンモニア除去性能及び圧力損失性能を示す図である。

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 佐々木 晴子

神奈川県横浜市鶴見区大黒町1-70 ニチアス株式会社内

(72)発明者 中野 寿朗

神奈川県横浜市鶴見区大黒町1-70 ニチアス株式会社内